

日本セラミックス協会関西支部
平成14年度 支部セミナー
- 出番を待つ期待のセラミックス技術 -

開催日時：平成14年12月 3日(火) 講演会 10:00~17:00
懇親会 17:15~19:00

場 所：メルパルク OSAKA (別紙の地図をご参照下さい)
大阪市淀川区宮原 4-2-1 TEL 06-6350-2111
<http://www.mielparque.or.jp/osk/osk01.html>

参加費：講演会(講演予稿集代を含む)
会員 3,000円 非会員 5,000円 学生 1,000円
懇親会 6,000円 *参加費は当日徴収致します。
(但し、講演者の方は参加費無料、懇親会はご招待とさせていただきます)

プログラム

10:00 開会挨拶 (司会 住友セメント(株) 山本貴憲)
関西支部 支部長 新原皓一

< 微細加工技術 >

10:05 1. ナノ・インプリント法による集積化ナノ構造作製 (座長 住友電気(株) 山川 晃)
大阪府立大学大学院 工学研究科 平井義彦
11:00 2. L I G Aプロセスのセラミックスへの応用
住友電気工業(株) 播磨研究所
平田嘉裕、沼澤稔之、仲前一男、高田博史

11:55 - 1300 昼 食

< ナイトライドセラミックス >

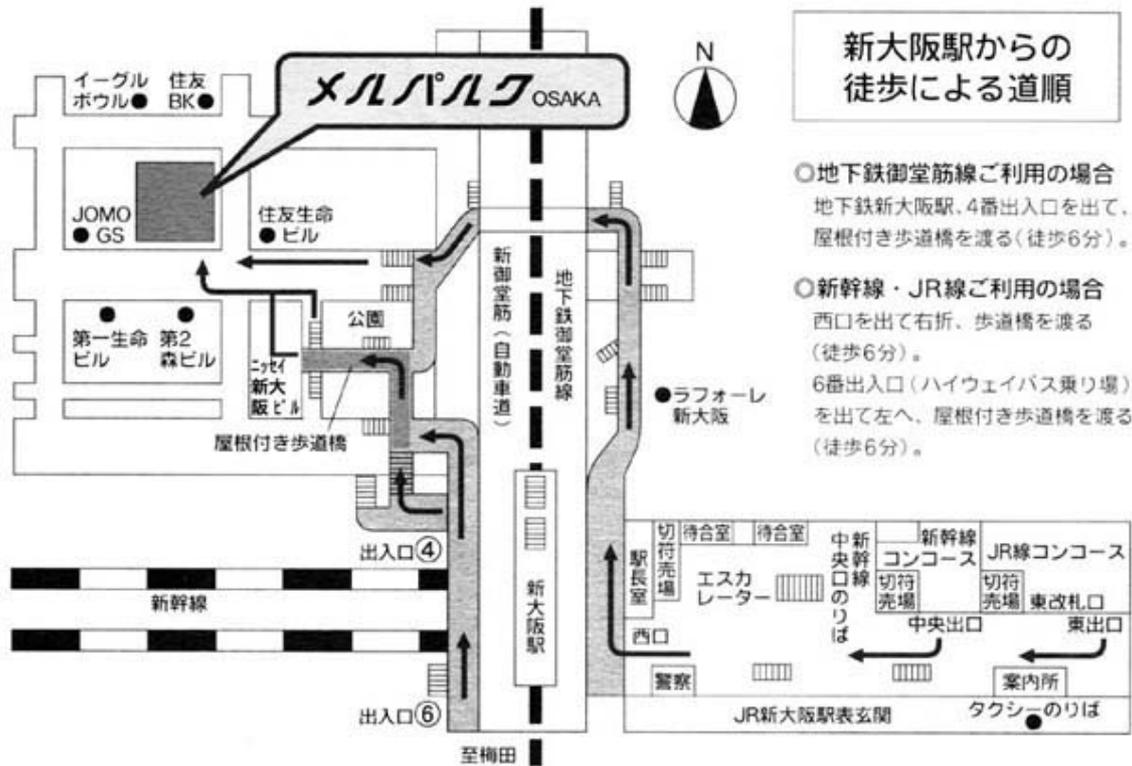
13:00 3. 希土類系複合金属窒化物の合成と機能 (座長 京都工芸繊維大学 田中勝久)
大阪大学 先端科学技術共同研究センター 町田憲一
13:55 4. 昇華近接法による単結晶 AlN の成長
京都工芸繊維大学 工芸学部 古庄智明、大島 悟、西野茂弘

14:50 - 15:00 休 憩

15:00 5. エアブリッジ構造を用いた低欠陥 GaN 基板の作製 (座長 龍谷大学 和田隆博)
松下電器産業(株) 先端技術研究所
石橋明彦、川口靖利、菅原 岳、長谷川義晃、横川俊哉
15:55 6. 多結晶 GaN、室温強磁性半導体 GaCrN と新機能デバイス
大阪大学 産業科学研究所 朝日 一

16:50 閉会挨拶 (司会 奈良先端科学技術大学院大学 大槻主税)
関西支部 副支部長 横尾 俊信

< 会場のご案内 >



<http://www.mielparque.or.jp/osk/osk01.html>

< 問い合わせ先 >

〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1
 大阪大学産業科学研究所 内
 日本セラミックス協会関西支部 事務局 関野 徹
 TEL 06-6879-8441, FAX 06-6879-8444
 E-mail csjk-office@sanken.osaka-u.ac.jp
<http://www.ceramic.or.jp/skansai/>